## 新 (平成29年10月20日農林水産省告示第1591号)

## 第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準

- ー 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
- 1 製造施設
- (1)・(2) (略)
- (3) 機械器具
- ア 表面に塗装、オーバーレイ、プリント、天然木化粧等の加工を施さないものを製造する場合にあっては、<u>表1</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。
- 表1 表面に塗装、オーバーレイ、プリント、天然木化粧等の加工を施さない合板の製造に必要な 機械器具

#### (表略)

イ 表面に塗装又はオーバーレイを施したものを製造する場合(コンクリート型枠用合板に限る。)にあっては、表2の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。ただし、表面に塗装又はオーバーレイを施すことのみを行う場合にあっては、オーバーレイ用接着剤塗布装置(接着剤を用いてオーバーレイを施す場合に限る。)、圧締接着装置(オーバーレイを施す場合に限る。)、目止め機(塗装を施す場合であって目止めをするときに限る。)、下地塗装機(塗装を施す場合に限る。)、仕上げ塗装機(塗装を施す場合に限る。)及び乾燥装置(塗装を施す場合であって乾燥をするときに限る。)に限る。

# 表2 表面に塗装又はオーバーレイを施したコンクリート型枠用合板の製造に必要な機械器具 (表略)

ウ 化粧ばり構造用合板を製造する場合にあっては、<u>表3</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。ただし、化粧単板の貼り合わせのみを行う場合にあっては、ダブルサイザー又はダブルソー、化粧単板用接着剤塗布装置及び圧締接着装置に限る。

## 表3 化粧ばり構造用合板の製造に必要な機械器具

## (表略)

エ 天然木化粧合板を製造する場合にあっては、<u>表4</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。

## 表4 天然木化粧合板の製造に必要な機械器具

## (表略)

オ 特殊加工化粧合板を製造する場合にあっては、次の表5から表8までに掲げる製造方法別

## 第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準

ー 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設

## 1 製造施設

(1) • (2) (略)

(3) 機械器具

ア 表面に塗装、オーバーレイ、プリント、天然木化粧等の加工を施さないものを製造する場合にあっては、<u>次の表</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。

IΒ

# [新設]

## (表略)

イ 表面に塗装又はオーバーレイを施したものを製造する場合(コンクリート型枠用合板に限る。)にあっては、次の表の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。ただし、表面に塗装又はオーバーレイを施すことのみを行う場合にあっては、オーバーレイ用接着剤塗布装置(接着剤を用いてオーバーレイを施す場合に限る。)、圧締接着装置(オーバーレイを施す場合に限る。)、目止め機(塗装を施す場合であって目止めをするときに限る。)、下地塗装機(塗装を施す場合に限る。)、仕上げ塗装機(塗装を施す場合に限る。)及び乾燥装置(塗装を施す場合であって乾燥をするときに限る。)に限る。

## [新設]

## (表略)

ウ 化粧ばり構造用合板を製造する場合にあっては、<u>次の表</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。ただし、化粧単板の貼り合わせのみを行う場合にあっては、ダブルサイザー又はダブルソー、化粧単板用接着剤塗布装置及び圧締接着装置に限る。

## [新設]

## (表略)

エ 天然木化粧合板を製造する場合にあっては、<u>次の表</u>の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。

## 「新設]

## (表略)

オ 特殊加工化粧合板を製造する場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる製造方法別の

の表のいずれかの表の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。

表 5 樹脂含浸紙熱圧硬化法による製造に必要な機械器具

(表略)

表6 樹脂加熱硬化法による製造に必要な機械器具

(表略)

表7 加圧法による製造に必要な機械器具

(表略)

表8 印刷法及び塗装法による製造に必要な機械器具

(表略)

力 保存処理を施しその旨を表示したものを製造する場合にあっては、表1及び表9の左欄に 掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の 右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。以下この号において同じ。)を備えているこ と。ただし、保存処理を施すことのみを行う場合にあっては、表9の左欄に掲げる機械器具 に限る。

表 9 保存処理を施す場合に必要な機械器具

機械器具	<u>条 件</u>
保存処理装置	加圧処理のできるものであって、処理むらの少ないものであること。

- 2 (略)
- 3 品質管理施設

次の機械器具を備えている適当な広さの施設であること。

(1)~(5) (略)

- (6) 保存処理を施しその旨を表示する場合にあっては、(1)から(3)までに規定するもののほか、 次のアからウまでに掲げる機械器具及びエからキまでの場合ごとに掲げる機械器具。
- ア 含水率測定用具
- イ 重量測定機
- ウ 濃度測定用具
- 工 ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合であって、 第三者機関による検定証明を定期的に取得しないとき ((ウ)に掲げる機械器具にあっては I C P (高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置により分析を行う場合、(オ)に掲げる機械器具にあってはクルクミン法により定量する場合に限る。)
  - (7) 天びん (カルミン酸法により定量する場合は感量が0.1mg以下、それ以外の場合にあっては感量が0.01g以下のもの)
  - (イ) 分光光度計
  - (ウ) ICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置

表のいずれかの表の左欄に掲げる機械器具(安定した能力を有し、連続した生産が可能であり、かつ、それぞれ同表の右欄に掲げる条件に適合しているものに限る。)を備えていること。

(7) 樹脂含浸紙熱圧硬化法

(表略)

(イ) 樹脂加熱硬化法

(表略)

(ウ) 加圧法

(表略)

(エ) 印刷法及び塗装法

(表略)

[新設]

- 2 (略)
- 3 品質管理施設

次の機械器具を備えている適当な広さの施設であること。

(1)~(5) (略)

「新設]

- (I) 恒温乾燥器
- (オ) 電気マッフル炉
- <u>(カ)</u> ガラス器具
- (キ) 雑器具
- 才 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合であって、第三者機関による検定証明を定期的に取得しないとき ((ウ)に掲げる機械器具にあっては原子吸光光度計により分析を行う場合、(エ)に掲げる機械器具にあっては I C P (高周波誘導結合プラズマ)発光分析装置により分析を行う場合、(オ)に掲げる機械器具にあっては蛍光 X 線分析装置により分析を行う場合に限る。)
  - (7) <u>天びん(蛍光X線分析装置により分析を行う場合にあっては感量が0.1mg以下、それ以外の場合にあっては感量が0.01g以下のもの)</u>
  - (1) 分光光度計
  - (ウ) 原子吸光光度計
  - (I) ICP (高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置
  - (オ) 蛍光 X 線分析装置
  - (カ) 恒温乾燥器
  - (キ) ガラス器具
  - (ク) 雑器具
- 力 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合であって、第三者機関による検定証明を定期的に取得しないとき ((イ)に掲げる機械器具にあっては原子吸光光度計により分析を行う場合、(ウ)に掲げる機械器具にあってはICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置により分析を行う場合、(エ)に掲げる機械器具にあっては蛍光 X 線分析装置により分析を行う場合、(オ)に掲げる機械器具にあってはガスクロマトグラフにより分析を行う場合、(カ)に掲げる機械器具にあっては高速液体クロマトグラフにより分析を行う場合に限る。)
  - (<u>7</u>) <u>天びん (蛍光 X 線分析装置により分析を行う場合にあっては感量が0.1mg以下、それ以</u> 外の場合にあっては感量が 1 mg以下のもの)
  - (イ) 原子吸光光度計
  - (ウ) ICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置
  - (I) 蛍光 X 線分析装置
  - (オ) ガスクロマトグラフ
  - (カ) 高速液体クロマトグラフ
  - (キ) 恒温乾燥器
  - (ク) ガラス器具
  - (ケ) 雑器具
- <u>キ</u> アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合であって、 第三者機関の検定証明を定期的に取得しないとき ((ウ)に掲げる機械器具にあってはガスクロマトグラフにより分析を行う場合に限る。)
  - (ア) 天びん (感量が1mg以下のもの)
  - (イ) 高速液体クロマトグラフ

- (ウ) ガスクロマトグラフ
- (I) 恒温乾燥器
- (オ) ガラス器具
- (カ) 雑器具
- 4 格付のための施設
- (1) (略)
- (2) 次に掲げる機械器具を備えていること。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

ア~ク (略)

- <u>ケ</u> 保存処理を施しその旨を表示する場合にあっては、ウに規定するもののほか、次の(ア)から (ウ)までに掲げる機械器具及び(エ)から(キ)までの場合ごとに掲げる機械器具を備えていること
  - (7) 恒温乾燥器
  - (イ) ガラス器具
  - (ウ) 雑器具
  - (I) ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合 (cに掲 げる機械器具にあっては I C P (高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置により分析 を行う場合、dに掲げる機械器具にあってはクルクミン法により定量する場合に限る。)
  - <u>a</u> 天びん (カルミン酸法により定量する場合は感量が0.1mg以下、それ以外の場合にあっては感量が0.01g以下のもの)
  - b 分光光度計
  - c ICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置
  - d 電気マッフル炉
  - (1) 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合 (cに掲げる機械器具にあっては原子吸光光度計により分析を行う場合、dに掲げる機械器具にあってはICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置により分析を行う場合、eに掲げる機械器具にあっては蛍光 X 線分析装置により分析を行う場合に限る。)
  - <u>a</u> 天びん(蛍光×線分析装置により分析を行う場合にあっては感量が0.1mg以下、それ以外の場合にあっては感量が0.01g以下のもの)
  - b 分光光度計
  - <u>c</u> 原子吸光光度計
  - d ICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置
  - e 蛍光 X 線分析装置
  - (カ) 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合 (bに掲げる機械器具に あっては原子吸光光度計により分析を行う場合、cに掲げる機械器具にあってはICP ( 高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置により分析を行う場合、dに掲げる機械器具 にあっては蛍光 X 線分析装置により分析を行う場合、eに掲げる機械器具にあってはガス クロマトグラフにより分析を行う場合、fに掲げる機械器具にあっては高速液体クロマト グラフにより分析を行う場合に限る。)
  - a 天びん(蛍光X線分析装置により分析を行う場合にあっては感量が0.1mg以下、それ以

- 4 格付のための施設
- (1) (略)
- (2) 次に掲げる機械器具を備えていること。ただし、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

ア~ク (略)

「新設]

外の場合にあっては感量が 1 mg以下のもの)

- b 原子吸光光度計
- c ICP(高周波誘導結合プラズマ)発光分光分析装置
- d 蛍光 X 線分析装置
- e ガスクロマトグラフ
- f 高速液体クロマトグラフ
- (キ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤により保存処理を施す場合 (cに掲) げる機械器具にあってはガスクロマトグラフにより分析を行う場合に限る。)
- a 天びん (感量が1mg以下のもの)
- <u>b</u> 高速液体クロマトグラフ
- c ガスクロマトグラフ
- 二 (略)
- 三 品質管理を担当する者の資格及び人数
- 1 品質管理担当者

品質管理担当者として、合板<u>(保存処理を施した構造用合板を製造する場合にあっては、保存</u><u>処理を施した構造用合板に限る。以下同じ。)</u>の製造又は試験研究に1年以上従事した経験を有する者が2人以上置かれていること。

2・3 (略)

四・五 (略)

第二 (略)

二 (略)

三 品質管理を担当する者の資格及び人数

1 品質管理担当者

品質管理担当者として、合板の製造又は試験研究に1年以上従事した経験を有する者が2人以 上置かれていること。

2・3 (略)

四・五 (略)

第二 (略)